

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和3年2月25日(2021.2.25)

【公表番号】特表2020-507678(P2020-507678A)

【公表日】令和2年3月12日(2020.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2020-010

【出願番号】特願2019-542079(P2019-542079)

【国際特許分類】

C 23 C 16/52 (2006.01)

H 05 H 1/46 (2006.01)

C 23 C 16/50 (2006.01)

H 01 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

C 23 C 16/52

H 05 H 1/46 A

C 23 C 16/50

H 01 L 21/302 101B

【手続補正書】

【提出日】令和3年1月13日(2021.1.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

調整可能なワークピースバイアス用システムであって、
ワークピースにプラズマ処理を実施するプラズマチャンバと、

前記プラズマチャンバ内で、ワークピースに直接に結合され、ワークピースの上方に位置する電極と結合された第1のパルス電圧源と、

前記ワークピースに容量結合された第2のパルス電圧源と、

前記ワークピースに向けられたイオンフラックスのイオンエネルギー分布を調整するために、前記第1のパルス電圧源及び前記第2のパルス電圧源の1つ以上のパラメータに基づいて、前記第1のパルス電圧源及び前記第2のパルス電圧源を独立に制御するバイアス制御装置とを備えるシステム。